2025 年 5 月吉日

芝浦メカトロニクス株式会社

当社の「次世代リソグラフィ用マスク洗浄装置　ARTS」、キヤノンが開発した世界初の量産用ナノインプリント半導体製造装置の開発製造拠点へ納入決定

芝浦メカトロニクス株式会社が開発・販売する「次世代リソグラフィ用マスク洗浄装置　ARTS(以下、ARTS)」が、キヤノン株式会社のナノインプリント半導体製造装置「FPA-1200NZ2C」の開発製造拠点向けに納入されることが決定しました。

当社は、2012 年よりナノインプリント用テンプレート向けの洗浄に取り組んでまいりました。今回、納入が確定した「ARTS」には、2015 年から技術開発を進め実用化した、凍結洗浄機能が搭載されています。凍結洗浄機能とは、超純水が凍る過程で膨張する特性を利用し、薬液を使わずに微細なパーティクルを除去する機能です。「ARTS」は、最適化された洗浄技術を用いる事で、要求されるナノインプリント用テンプレートの洗浄への適用が期待されています。

今回の納入を足掛かりとし、半導体回路パターンのさらなる微細化と環境負荷の大幅な低減を実現したナノインプリント用テンプレートの洗浄工程へと、「ARTS」の適用を拡大していきます。

【お問い合わせ先】
芝浦メカトロニクス株式会社
ファインメカトロニクス事業部
https://www.shibaura.co.jp/inquiry/